

**Lumina-200** 高分辨率光刻机加对准系统经过了大量的实时实地验证，质量可靠，性能优越稳定。**Lumina**系列是一款具有高性能，高可靠性，高性价比，兼具接触和近程光刻的高分辨率，高对准精度全功能光刻机和模板基板对准机。**Lumina**系列在电子，光电子，MEMS，生物芯片等诸多领域都有广泛应用。**Lumina-200**具有极佳的用户界面，高精度的机械平台，高精度光学，紧凑的系统设计。

## 主要特点

- 高光刻分辨率
- 高精度对准机械平台
- 最新高精度对准光学系统
- 精确的间距控制
- 极佳的计算机用户界面
- 紧凑的系统设计
- 高性价比设计
- 可附加背面对准功能

### 应用：

- 半导体器件
- 光电子器件
- **MEMS**
- 高端封装
- 功率器件
- 生物芯片

基于超过12年、15代产品开发经验的自动化操作

**Nanonex**经过大量实时实地验证，质量可靠，性能优越稳定



**Lumina-200 多功能高精度光刻机**

## 系统参数

### 主平台

- 手动控制 X-Y-θ
- 马达控制 Z
- 调节范围：
  - X和Y: 1英寸
  - θ: 10度
  - Z: 0.25英寸

### 模板加载能力

- 5"标配模板
- 其他尺寸可提供

### 基板加载能力

- 4"标配基板
- 其他尺寸可提供

### 对准模式

- 近程，软，硬接触

### 对准光学

- 分场光学
- 5X物镜，1到7X ZOOM
- 2轴独立手动X,Y,Z显微镜调节
- 粗略和精细对焦
- 通过CCD相机成像

### 曝光系统

- 紫外：水银灯G或I线可选
- 紫外灯功率：500瓦
- 均匀紫外曝光
- 马达带动紫外光源

## 其他参数

配有微软Windows的电脑控制系统  
用户友好的控制软件

计算机控制的CCD视频

计算机控制的紫外光曝光

设备占地面积：31" × 44"  
(780 mm × 1110 mm)

应用领域：半导体器件，光电子、显示器、数据存储介质、先进材料、生物科技、微米流道等